(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年10 月20 日 (20.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/098915 A1

(51) 国際特許分類7: H01L 21/301, B23K 26/00 // 101:40

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/005552

(22) 国際出願日:

2005年3月25日(25.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-100931 2004年3月30日(30.03.2004) 万

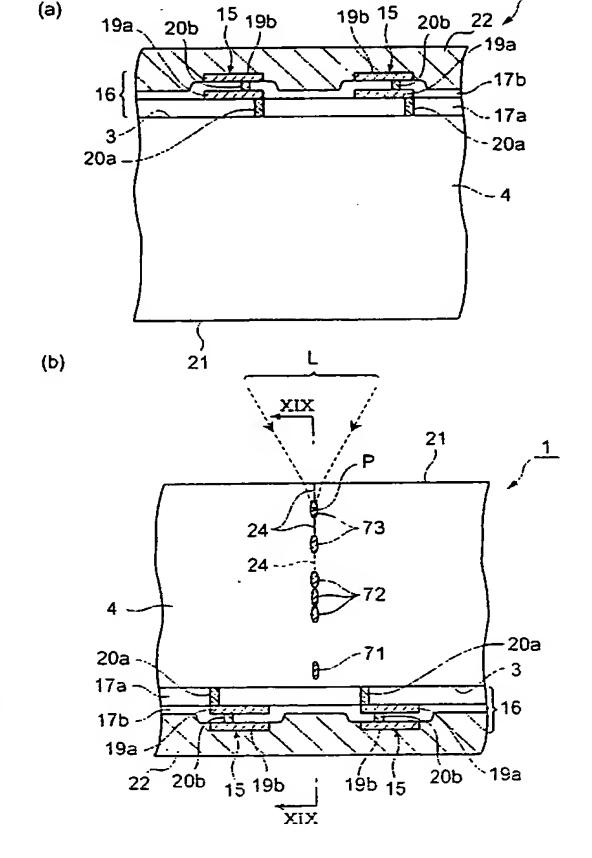
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 坂本 剛志 (SAKAMOTO, Takeshi) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜

松市市野町1126番地の1浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 福満 憲志 (FUKUMITSU, Kenshi) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0番 6 号銀座 ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

- (54) Title: LASER PROCESSING METHOD AND SEMICONDUCTOR CHIP
- (54) 発明の名称: レーザ加工方法及び半導体チップ



(57) Abstract: A laser processing method is provided for highly accurately cutting a board and a stacked part, even when the board whereupon the stacked part including a plurality of functional elements is formed is thick. In the laser processing method, a laser beam L is projected, having a rear plane (21) as a laser beam incidence plane, with a light collecting point P inside of a board (4), and modified areas (71, 72, 73) are formed inside the board (4). At this time, the quality modified area (71) is formed at a position which permits a distance between a surface (3) of the board (4) and a surface side edge part of the quality modified part (71) to be 5μ m- 15μ m. When the quality modified area (71) is formed at such position, a stacked part (16) (in this case, interlayer insulating films (17a, 17b) formed on the surface (3) of the board (4) can be accurately cut along a cut planned line with the board (4).

(57) 要約: 複数の機能素子を含む積層部が形成された基板が厚い場合であっても、基板及び積層部の高精度な切断を可能にするレーザ加工方法を提供する。 このレーザ加工方法を提供する。 このレーザ光入射面として基板4の内部に集光点Pを合わせてレーザ光しを照射することで、改り表面3と品質では、基板4の表面3に品質では、一個域71、72、73を基板4の内部に形成する。このような位置に品質では、一個域71を形成している。このような位置に品質では、一個域2000ででは、基板4と共に、基板4の表面3に形成された積層的16(ここでは、層間絶縁膜17a、17b)も切断でラインに沿って精度良く切断することができる。

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書